UPGRADE OF EXPERIMENTAL APPARATUS FOR POLARIZED PHOTOCATHODE

Kazuharu NISHITANI

ATC Co., Ltd.

36-7 Namiki-cho, Hachioji-shi, Tokyo, 193 Japan

ABSTRACT

(P) – **9**

Ultra-high vacuum is required for an experimental apparatus of polarized photocathode. A gun is baked at 150°C for 50 hours and evacuated with the combination of the sputter ion pumps and the NEG pumps. The vacuum pressure of $6x10^{-11}$ torr was achieved for the base pressure. The gun is processed by the conditioning of the DC high voltage up to 110kV with N₂ gas ranging of $10^{-8} \sim 10^{-7}$ torr. The amount of the dark current is less than 1nA at 70kV of applied voltage. Two ion pumps mounted near the beam line are surrounded by the permalloy plates to magnetic shield. The magnitude of the leakage magnetic field of the ion pumps is smaller than the earth magnetism across the beam line.

偏極電子フォトカソード試験装置の改良

1. はじめに

ELECTRON GUN

ION GAUGE

& QMS

Cs DISPENSER

次世代リニアコライダーでは、電子ビームはスピン偏極ビームを使用することが考えられている。 現在、KEKのAccelerator Test Facility (ATF)ではリニアコライダー計画の偏極電子銃の開発に向けた数々の研究が行われている。そのなかにガリウム砒素系の結晶をフォトカソードとして用いる研究開発があり、それら試験のための装置も製作された。この試験装置は図1に示すように、直流電子銃、ビームトランスポート、偏極度測定器で構成されている。

CATHODE

ROD



2. 電子銃

1) 超高真空

電子銃の真空排気は到達真空度10⁻¹¹Torr台を目 標に排気速度200ℓ/SのイオンポンプとNEGポンプ で行う。ベーキングは磁気浮上ターボポンプとド ライ式真空ポンプであるドライバックを使った完 全オイルフリーの粗排気システムで排気しながら, 電子銃全体を断熱パネルで囲み,150℃で50時間行 う。NEGはベーキング終了直前に活性化する。



SHIELDED

200L/S

ION PUMP

図1 偏極電子銃フォトカソード試験装置構成図

ベーキング後の到達真空度は6×10⁻¹¹Torrである。 図2に残留ガスの分圧を示す。真空度が1.4×10⁻¹⁰ Torr なのは質量分析器の放出ガスによるものであ る。





2) 高電圧プロセシング

この電子銃はフォトカソードを装着するため高 電圧印加によりウエーネルトから電界放出される 暗電流を極力抑える必要がある。また試験で引き 出すカソード電流が数nAと微小なこともあり、よ り正確な電流計測を行うためには絶縁管の縁面電 流も少ないことが要求される。そこでベーキング 後の高電圧プロセシングではチッソガスを導入さ せながら,いわゆるチッソエージングを行っている [2]。チッソガスはスローリークバルブで真空度が 10⁻⁸~10⁻⁷Torr を維持するよう調整する。カソード は加速されたイオン分子の衝撃を受けないようカ ソードを取り付けてあるロッドを上に引き上げウ エーネルトから遠避ける。電圧は110kVまで高圧 電源電流を監視しながら上げてゆく。通常、エージ ングを数時間行うと電流は110kV印加で100nA以下 になる。通常運転電圧である70kV印加では10nA以 下、さらにエージングを続けると1nA以下まで低下 する。

3. ビームトランスポート

1) 招高真空

電子銃の超高真空を維持するためにはビームト ランスポートも超高真空であることが要求される。 そこで,ビームトランスポートの真空排気もイオン ポンプとNEGポンプで行うことにした。偏向マグ ネットの下流側とトランスポート最下流に、 ϕ 5mm のコリメーターがあるので、マグネットより上流側 は200ℓ/Sのイオンポンプと50ℓ/SのNEGポンプ、下 流側は20ℓ/Sのイオンポンプと100ℓ/SのNEGポン プを取付け、差動排気とした。ベーキングは電子銃 と同じ工程を行うが、加熱はテープヒーターを巻き つけて行う。到達真空度は1.2×10⁻¹⁰Torr である。

2) 収束レンズ

収束レンズは、イリノイ大学のCEBAF偏極電子源

で使われているものを参考に設計した^[3]。図3に示 すよう漏れ磁場を低減するためにコイルはリター ンヨークで囲み,ビームパイプをはめ込む一体構造 にした。しかし,ビームパイプはベーキングするた め収束レンズも150℃以上の耐熱を必要とする。そ こで,巻き線はポリアミドイミドエナメル線,接着 剤はサーミッドポリイミド,絶縁シートはキャプト ンを使用して,耐熱温度180℃とした。図4にZ方向 の磁束分布を示す。





Z [cm]

10

3) 磁気シールド

-10

通常運転電圧の70kVで加速されたビームの移送 では地磁気たりとも無視は出来ない。ただし地磁 気は一様に分布しているので、ステアリングコイル での補正で十分であるが、イオンポンプなどの漏れ 磁場は局所的な分布を示すので厄介である。そこ でビームトランスポートに取付けてある2つのイオ ンポンプのうち200ℓ/S のものはスペースの余裕も あるので遠避けることにし、20ℓ/Sのものは排気速 度を低下させたくないので磁気シールドをするこ とにした。シールド材は厚さ2mmのパーマロイ (Ni45%)の板を使い立方体の箱を作り、その中にイ オンポンプを入れる。ただしフランジとフィード スルーは箱の外に出ている。図5に漏れ磁束が最大 であったフランジ方向の磁束分布を示す。フラン ジ面で2ガウス程度だが、3cm離れたところでは地 磁気程度になっている。また,箱の角表面に2ガウ ス程度の漏れ磁束があるが、これも3cm離れれば 0.3ガウス以下になっていた。また,電子銃のイオ ンポンプも同様にシールドし、ビームラインでの漏 れ磁束は地磁気以下になった。



図5 シールドしたイオンポンプの漏れ磁束分布

3. モットチェンバーの真空度改善

モットチェンバーの内部にはモット散乱を検出 する半導体があり、ベーキングが行えないこともあ って、60ℓ/Sのイオンポンプだけでは到達真空度が 1.4×10-8Torr と、ビームトランスポートの2桁高い 圧力になっていた。ゲートバルブを開いた時の電 子銃の真空度悪化を抑えるためにも真空度の改善 が必要であった。ここでは真空管などのゲッター ポンプとして使われている非蒸発型ポーラスゲッ ター(ST172, サエスゲッター社)を取付け, 排気速度 の増強を図った。ST172はポーラス状の非蒸発型 ゲッター材を任意の形状にしたもので、その内部に は活性用のヒーターが埋め込まれている。図6に示 すようにST172を真空ポンプとして使用するため ICF-70 フランジのフィードスルーにヒーターのリ ード線を接続,固定したものを4台作り,モットチェ ンバーのポートに取付けた。



図6 ST172 真空ポンプ

活性化中の放出ガスは外部排気を使わず、60 ℓ /Sの イオンポンプで排気しながら行った。活性時間は ヒーター電流7Aで10分間、ただし7Aになるまでは イオンポンプの加熱をさけるため10⁻⁶Torr以下の圧 力を保つよう約20分かけて電流を上げていった。 図7に真空度とST172推定排気速度の変化を示す。 1台を活性化して1日後に7.2×10⁻⁹Torrの真空度と なった。活性前1.4×10⁻⁸Torrでのイオンポンプの 排気速度が30 ℓ /Sであると仮定するとモットチェ ンバーでの実効排気速度は20 ℓ /S程度と見積られ る。真空度と実効排気速度から放出ガス量は 5.6×10⁻⁷Torr ℓ /Sとなり、到達した真空度7.2×10⁻⁹ Torr になるには39 ℓ /Sの排気速度を要する。した がって、ST172の排気速度は19 ℓ /Sと推定される。 21日後に真空度は8.9×10⁻⁹Torrで落ち着いた。こ の時点でのST172の排気速度は11 ℓ /Sとなる。次に 2台目を活性化すると1日後にST172の排気速度は 2台合わせて34 ℓ /Sとなり、2台目が23 ℓ /Sを有して いたことになる。21日後の排気速度は2台合わせて 25 ℓ /Sに落ち着いた。さらに1台目を再活性したが 排気速度の変化は2台目の活性後と同様で、約100日 後の真空度は7×10⁻⁹Torrで落ち着いている。排気 速度の低下は、ST172吸着面の飽和によるものと考 えられるが、活性化時の放出ガスを外部排気しなが ら残り2台を含めた4台を活性化することで、さらに 低い圧力を長期間、維持することが期待できる。



図7 ST172活性化による真空度およびび排気速度の変化

4. まとめ

今回の改良によって電子銃の真空度は下流のゲ ートバルブを開いた状態でも10⁻¹¹Torr台を十分維 持できるようになりカソードの寿命が延びた。ま た,漏れ磁場の排除によりビームの移送効率が改善 され,試験装置として使用できるまでになった。今 後は,フォトカソードに係わる取り扱い方法の改善 を行う予定である。

謝辞

試験装置の改良にあたっては、KEKおよび名古屋 大学のLC開発グループ、特にフォトカソード電子 銃グループの皆様の御協力に感謝致します。また 東北金属(株)の松本教之、中村崇憲両氏にはそれぞ れ収束レンズ、磁気シールド製作に御協力頂き、 SLACのDavid Schultz氏にはSLACにおける経験を 快く教えて頂きました。

参考文献

- Proceedings of the Workshop on Photocathodes for polarized Electron Sources for Accelerators, SLAC-432 Rev. April 1994 に残留ガスとフォトカソードの寿命 に関する論文が多く出ている。
- [2] David Schultz, Private communications.
- [3] B.M. Dunham, Investigations of the Physical Properties of Photoemission Polarized Electron Sources for Accelerator Applications, Thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign Press, P40-43, 1993.